

2015年2月4日

韓国の高純度亜酸化窒素製造拠点 増強を完了

昭和電工株式会社（社長：市川 秀夫）は、半導体製造用特殊ガスのひとつである高純度亜酸化窒素の供給能力を拡大する目的から、韓国の株式会社斗岩産業（社長：朴晔、本社：京畿道安城市）と共同で、ソウル近郊の同社工場内に精製設備を建設していましたが、このたび設備が完成し、3月より本格的に運転を開始いたします。

高純度亜酸化窒素は、半導体 CVD プロセスでの絶縁酸化膜形成用ガスとして使用される特殊ガスであり、アジア地区での半導体用途での需要は年率 10%以上の拡大が見込まれます。また、近年はディスプレイ製造時の酸化膜の酸素源としての用途も広がっており、高純度亜酸化窒素の需要拡大にあわせ、当社グループの供給体制を強化しました。

今回の拠点増強により、当社グループの高純度亜酸化窒素供給能力は、当社川崎事業所における年間生産能力 1,200 トンと、韓国での生産能力 600 トンを加えた 1,800 トンに増強されます。

当社では、現在推進中の中期経営計画「PEGASUS（ペガサス）」フェーズⅡにおいて、高純度アンモニアをはじめとする半導体高純度ガスを成長事業に位置づけております。今後、アジア地区を中心にグローバル展開をさらに推進し、拡販に注力していきます。

以上

◆本件に関するお問い合わせ先 広報室 03-5470-3235

【韓国の高純度亜酸化窒素製造設備】

